

國立臺灣大學技術行銷表

台大案號: _____ (由產學合作中心填寫)

產學合作中心聯絡人: _____ 電話: _____ e-mail: _____

產品/技術名稱	曝光系統
發明人/單位	郭宇軒、蘇明信、盧奕璋、蔡坤諭 (電機系/電子所)
產品/技術說明	多電子束曝光系統以模組化方式形成，以降低系統成本，並達致高速曝光之目標。
應用範圍	半導體製程
產品/技術優勢	<ul style="list-style-type: none"> ● 模組化 ● 高寫入速度 ● 低機器建造成本
市場潛力	可用於 22nm 以下之新世代製程。
產品/技術 智財權保護方式	(由產學合作中心填寫)

Marketing Abstract of NTU's Invention Disclosure

NTU's docket no: _____ (由產學合作中心填寫)

CIAC contact :

Tel :

e-mail :

Title	Exposure System
Inventor (s)	Yu-Hsuan Kuo, Ming-Shing Su, Yi-Chang Lu, Kuen-Yu Tsai
Brief Description	The multi-electron-beam system can be implemented using a module concept, thus reducing the machine-building cost and yield while proving a high production rate.
Fields of Application	IC Fabrication Technology
Advantages	<ul style="list-style-type: none"> ● Modulized Design ● High Throughput ● Low Building Cost
Market Potential	Targeted at sub-22-nm technology node for semiconductor manufacturing.
IP Right(s)	(由產學合作中心填寫)